2025 年 5 月 19 日

開催案内
ワークショップ NGL2025

応用物理学会次世代リソグラフィ（NGL）技術研究会では、今年も NGL ワークショップ（ワークショップ NGL2025）を開催する予定です。本年も多くの方々に参加していただきたく、下記に概要をお知らせいたします。3 件の基調講演をはじめ、充実したプログラムを準備いたしました。皆様のご参加をお待ちしております。

応用物理学会　次世代リソグラフィ技術研究会
幹事長　宮本 恭幸

記

会期：２０２５年７月３日（木)、４日（金）
会場：東京科学大学 蔵前会館*（東急目黒線、大井町線大岡山駅前）
*詳細については蔵前会館のホームページ（下記 URL）をご覧ください。
http://www.somuka.titech.ac.jp/ttf/access/index.html

プログラム概要：

基調講演：

“アジャイル・ダイナミック時代の知の越境と価値創造：半導体・量子・AI の未来を拓く”
益一哉氏（産業総合技術研究所）

“Scaling EUV and holistic lithography to support Moore's Law”
Michael Lercel 氏（ASML）

“先端リソグラフィにおけるマスク技術の現状”
吉川 真吾氏（大日本印刷）

技術セッション：

7/3　光リソグラフィ＆アドバンストパターニング、レジスト材料、ポスターセッション
7/4　ナノインプリント、EB・計測・マスク技術、EUVL
※ポスターセッションでは軽食を提供いたします。

主催：　応用物理学会 次世代リソグラフィ技術研究会（分科会）
協賛：　応用物理学会 シリコンテクノロジー分科会

NGL2025 企画運営委員会：

委員長：宮本 恭幸　副委員長：岡崎 信次

委員　：備前 大輔、古澤 孝弘、井谷 俊郎、中川 勝、石原 直、松井 真二、堀内 敏行、田川 精一、三田 吉郎、雨宮 智宏、落合 幸徳、老泉 博昭、笑喜 勉、酒井 啓太、尹 成圓、鈴木 章義、渡邉 陽司、引地 龍吾、伊藤 高臣、岩城 友博、古巻 貴光、本多 孝義、谷川 貴紀、幡野 正之、原田 哲男

事務局：相良好美

TEL：090-5403-1147

E-mail： ngl@jsap.or.jp

参加費※：税込み（消費税課税）表示

主催・協賛団体会員、学生：　３,０００円（６月１６日以前の申し込み）

４,０００円（６月１７日以降の申し込み）

一般：　１８,０００円（６月１６日以前の申し込み）

２０,０００円（６月１７日以降の申し込み）

※申し込み後、指定の期日までにクレジットカード、コンビニ決済等でお支払いください。

申し込み方法：　下記の申し込み専用ホームページからお申し込みください。

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=2826022165321700&EventCode=1054434041

応用物理学会次世代リソグラフィ技術研究会は、本ワークショップの他、年に３回程度、会員が無料で参加できる定例研究会を開催しております。当研究会には、法人（賛助）会員、個人会員としての入会が可能です。ご興味のある方は上記事務局までご連絡ください。

以上